

平成16年（行ケ）第509号 特許取消決定取消請求事件  
口頭弁論終結日 平成17年3月28日

原告	被告	ソニー株式会社
訴訟代理人弁理士		小池 晃
同		田村 榮一
同		伊賀 誠司
同		藤井 稔也
同		野口 信博
被告		特許庁長官 小川 洋
指定代理人		岡野 卓也
同		西川 惠雄
同		岡田 孝博
同		宮下 正之

主 文  
1 特許庁が異議2003-70766号事件について平成16年9月28日にした決定中、「特許第3326642号の請求項1, 5, 6及び11に係る特許を取り消す。」との部分を取り消す。

2 訴訟費用は原告の負担とする。  
事実及び理由

1 原告の請求

- (1) 主文1項と同旨。
- (2) 訴訟費用は被告の負担とする。

2 当事者間に争いのない事実

- (1) 特許庁における手続の経緯

原告は、発明の名称を「基板の研磨後処理方法およびこれに用いる研磨装置」とする特許第3326642号の特許（平成5年11月9日出願、平成14年7月12日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は14である。）の特許権者である。

本件特許に対し、請求項1ないし14につき、特許異議の申立てがあり、特許庁は、この申立てを、異議2003-70766号事件として審理した。原告は、この審理の過程で、平成16年4月5日、本件特許の出願に係る願書に添付した明細書の訂正の請求をした。特許庁は、上記事件につき審理し、その結果、平成16年9月28日、「訂正を認めない。特許第3326642号の請求項1乃至14に係る特許を取り消す。」（以下、請求項1ないし14に係る発明をまとめて「本件各発明」という。）との決定をし、同年10月18日、その謄本を原告に送達した。

- (2) 決定の理由

要するに、本件各発明は、公知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定に該当する、したがって、本件特許は、請求項1ないし14のいずれについても、この規定に違反して登録されたものである、ということである。

- (3) 訂正審判の確定

原告は、本訴係属中に、本件特許の出願に係る願書に添付した明細書の訂正をすることについて審判を請求した。特許庁は、これを訂正2005-39010号事件として審理し、その結果、平成17年2月22日に訂正（以下「本件訂正」という。）することを認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）をし、これが確定した。本件訂正は、請求項1, 5, 6, 及び11（以下、これらの請求項に係る発明を「本件訂正発明」という。）を順次請求項1ないし4とした上で次のとおり訂正するというものである（請求項2ないし4, 7ないし10, 12ないし14は削除された。）。

- (4) 本件訂正前の本件訂正発明の特許請求の範囲

「【請求項1】基板に研磨処理を施した直後から後処理が終了するまでの間、シャワーヘッド又は超音波加湿器により、該基板の湿潤状態を維持することを特徴とする基板の研磨後処理方法。

【請求項5】前記薬液洗浄工程ではスピン洗浄を行うことを特徴とする請求項3または請求項4に記載の基板の研磨後処理方法。

【請求項6】基板に研磨処理を施す研磨ユニットと、該基板の洗浄処理を行

う洗浄ユニットと、該基板の rins および乾燥を行う rins／乾燥ユニットとを備え、隣接するこれらユニット間が、シャワーヘッド又は超音波加湿器により前記基板を湿潤雰囲気下で搬送可能なユニット間湿潤搬送機構により連結されてなることを特徴とする研磨装置。

【請求項 11】前記薬液洗浄室は、スピン洗浄手段を備えてなることを特徴とする請求項 9 または請求項 10 に記載の研磨装置。」

(5) 本件訂正後の本件訂正発明の特許請求の範囲（下線部が本件訂正による訂正箇所である。）

「【請求項 1】化学機械研磨ユニットにおいて基板に対して化学機械研磨を施す化学機械研磨工程と、

前記化学機械研磨ユニットにより化学機械研磨が施された前記基板を、洗浄ユニットの互いに隣接する複数の洗浄室に順次搬送して、物理洗浄と薬液洗浄の洗浄処理を施す洗浄工程と、

rins／乾燥ユニットにおいて前記洗浄ユニットにより洗浄された前記基板に rins 及び乾燥処理を施す rins／乾燥工程を有し、

互いに隣接し、ゲートバルブが設けられた隔壁により分離された前記化学機械研磨ユニットと前記洗浄ユニットとの間、及び互いに隣接し、ゲートバルブが設けられた隔壁により分離された前記洗浄ユニットと前記 rins／乾燥ユニットとの間に亘って、前記ゲートバルブを介して前記基板を搬送する際、前記化学機械研磨ユニットと前記洗浄ユニットとの間、及び前記洗浄ユニットと前記 rins／乾燥ユニットとの間にそれぞれ配置されたシャワーヘッド又は超音波加湿器を備えるユニット間湿潤搬送機構により湿潤状態を維持して搬送するとともに、

前記洗浄ユニットの前記複数の洗浄室間に設けられたゲートバルブを介して前記洗浄室間に亘って前記基板を搬送する際、前記洗浄室間に配置されたシャワーヘッド又は超音波加湿器を備えるユニット内湿潤搬送機構により湿潤状態を維持して搬送することを特徴とする基板の研磨処理方法。

【請求項 2】前記薬液洗浄は、スピン洗浄により行われることを特徴とする請求項 1 記載の基板の研磨処理方法。

【請求項 3】基板に対して化学機械研磨を施す化学機械研磨ユニットと、

前記化学機械研磨ユニットにより化学機械研磨が施された前記基板の物理洗浄を行う少なくとも 1 基の物理洗浄室と、前記基板の薬液洗浄を行う少なくとも 1 基の薬液洗浄室とが互いに隣接して設けられ、各洗浄室において前記基板を順次洗浄する洗浄ユニットと、

前記洗浄ユニットにより洗浄された前記基板に rins 及び乾燥処理を施す rins／乾燥ユニットとを有し、

前記化学機械ユニットと、前記洗浄ユニットと、前記 rins／乾燥工程ユニットとは直列に配列され、

互いに隣接する前記化学機械研磨ユニットと前記洗浄ユニットとの間及び前記洗浄ユニットと前記 rins／乾燥ユニットとの間は、それぞれゲートバルブが設けられた隔壁により分離されるとともに、前記化学機械研磨ユニットと前記洗浄ユニットとの間及び前記洗浄ユニットと前記 rins／乾燥ユニットとの間のそれぞれに、シャワーヘッド又は超音波加湿器を有し、前記各ユニット間に亘って搬送される前記基板の湿潤状態を維持して搬送するユニット間湿潤搬送機構が設けられ、

さらに、前記洗浄ユニットの互いに隣接する前記複数の洗浄室間に、シャワーヘッド又は超音波加湿器を備えるとともにゲートバルブを備え、前記ゲートバルブを介して前記洗浄室間に亘って搬送される前記基板の湿潤状態を維持して搬送するユニット内湿潤搬送機構が設けられていることを特徴とする研磨装置。

【請求項 4】前記薬液洗浄室は、スピン洗浄手段を備えていることを特徴とする請求項 3 記載の研磨装置。」

### 3 当裁判所の判断

上記当事者間に争いのない事実によれば、本件訂正前の特許請求の範囲の請求項 1、5、6 及び 11 の記載に基づき、その発明を認定し、これを前提に、特許法 29 条 2 項の規定に違反して登録された特許であることを理由に、同請求項について本件特許を取り消した決定の取消しを求める訴訟の係属中に、当該特許に係る特許請求の範囲の減縮を含む訂正の審判が請求され、特許庁は、これを認める本件訂正審決をし、これが確定したといえることができる。

決定は、これにより、結果として、本件訂正前の上記請求項 1、5、6 及び 11 について判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったことになり、この誤り

が上記請求項について決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって、決定は、上記請求項につき、取消しを免れない。

以上によれば、本訴請求は理由がある。そこで、これを認容し、訴訟費用の負担については、原告に負担させるのを相当と認め、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法62条を適用して、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所知的財産第3部

裁判長裁判官	佐	藤	久	夫
裁判官	設	樂	隆	一
裁判官	若	林	辰	繁